

研究タイトル:

酸化物薄膜抵抗スイッチング特性と そのノイズ特性評価



氏名:	佐久間 敏幸 / Sakuma Toshiyuki	E-mail:	sakuma@wakayama-nct.ac.jp
職名:	教授	学位:	博士(工学)

所属学会・協会: 応用物理学会、IEEE

キーワード: 薄膜, 抵抗スイッチング, 酸化物薄膜, ノイズ

技術相談

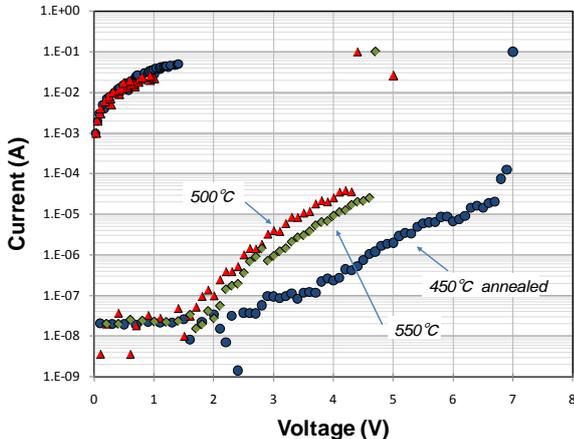
提供可能技術:

- ・溶液法による酸化物薄膜作製
- ・貴金属薄膜のリフトオフプロセス
- ・電流電圧およびノイズ特性評価

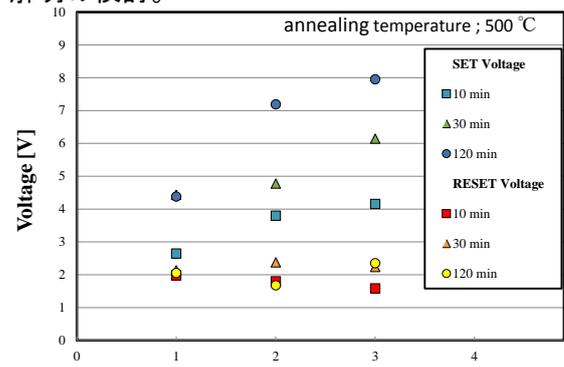
研究内容: 酸化物薄膜抵抗スイッチング特性とそのノイズ特性評価

酸化物 (NiO, TiO₂, HfO₂, ZnO 等) 薄膜の抵抗スイッチングを利用した電子デバイスへの応用。溶液法による酸化物薄膜作製と電気特性評価のための上下 Pt 電極のリフトオフによるパターン形成。低抵抗状態および高抵抗状態の抵抗

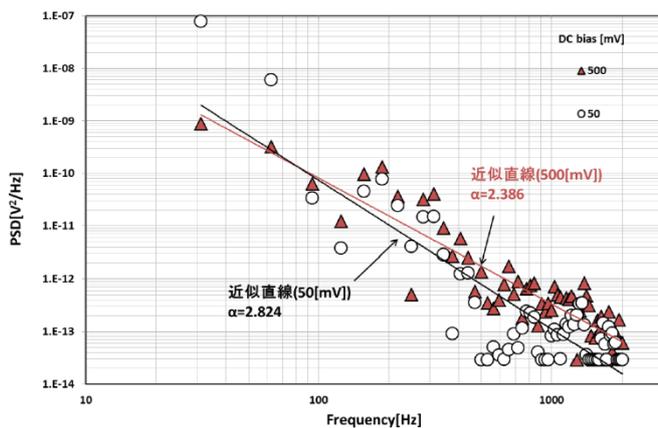
ノイズ特性評価による抵抗スイッチング特性の機構解明の検討。



溶液法による NiO 薄膜の電流電圧特性



塗り回数によるスイッチング特性変化



溶液法による NiO 薄膜(高抵抗状態)の PSD 特性

提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)
